

บทที่ 4

ผลการวิจัย

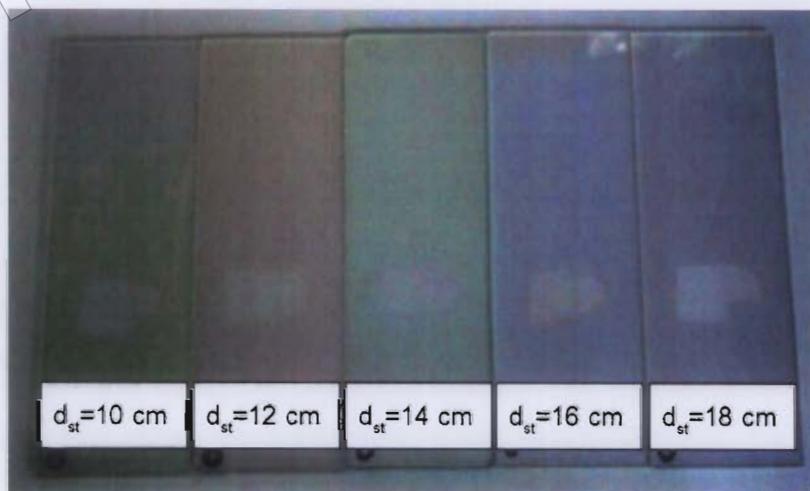
บทนี้กล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 ประกอบด้วย ผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับ ผลของยัต្តาไฟลแก๊สออกซิเจน และ ผลทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับ

ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาโดยสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่เคลื่อน เมื่อแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับต่าง ๆ กำหนดให้อัตราไฟลแก๊สออกซิเจน ต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm : 6 sccm กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 220 W เคลื่อนนาน 120 min และ แปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับ (d_{st}) เท่ากับ 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm และ 18 cm ตามลำดับ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ โดยสร้างผลลัพธ์ค่าคงที่แล็ตทิช ขนาดผลลัพธ์ ความหนา และลักษณะพื้นผิว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์

ฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่เคลื่อน ได้มีอัตราระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อน กับวัสดุรองรับต่าง ๆ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลักษณะใส ส่องผ่านแสงได้ดี มีสีม่วง หรือ เขียวอ่อน ๆ แต่เมื่อนำไปดูในระยะห่างของเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับ (d_{st}) ดังแสดงในภาพที่ 4-1

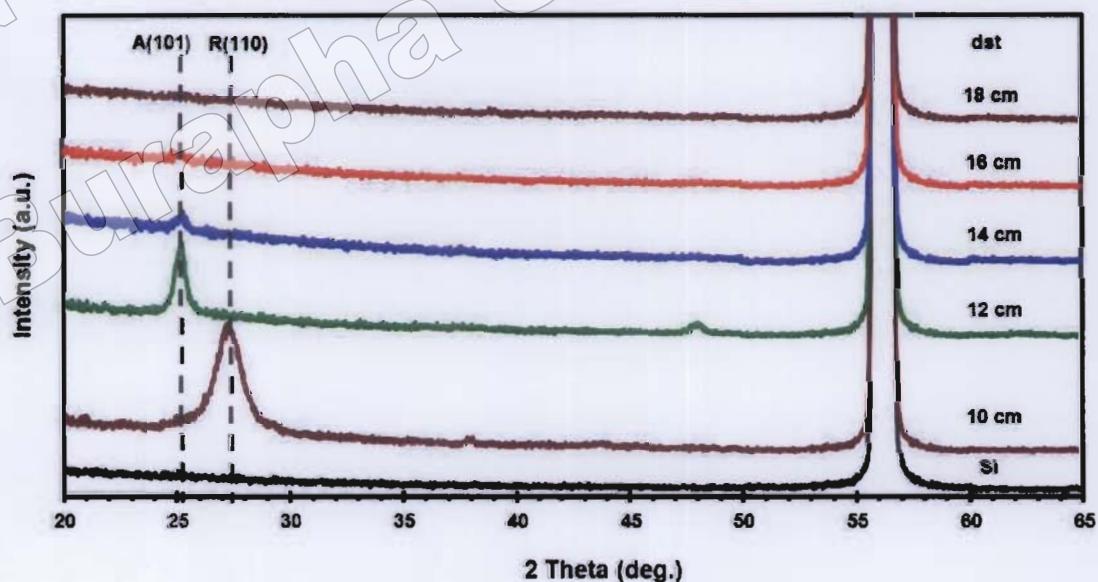


ภาพที่ 4-1 ลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่เคลื่อนบนกระจกสไลด์ เมื่อเคลื่อนด้วยระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลื่อนกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

2. โครงสร้างของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์

ฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง โดยแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ ได้แก่ 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm และ 18 cm มีผลการทดลองดังนี้

ภาพที่ 4-2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบได้ โดยแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ พนว่าฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ระยะ d_{L} เท่ากับ 10 cm มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่มุม 27.50° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์ ระนาบ (110) เมื่อเพิ่มระยะ d_{L} เมื่อเท่ากับ 12 cm และ 14 cm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่มุม 25.24° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส ระนาบ (101) สำหรับระยะ d_{L} เมื่อเท่ากับ 16 cm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เริ่มปรากฏลักษณะโครงสร้างแบบอัมอร์ฟัส (amorphous) และที่ระยะ d_{L} เมื่อเท่ากับ 18 cm ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ สำรวจที่มุม 56.50° เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของซิลิกอนซึ่งใช้เป็นวัสดุรองรับ



ภาพที่ 4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์สามารถหาได้จากระยะห่างระหว่างรัษนาผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบบูร์ไกล์และแบบอนาเทส เนื่องจากฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบได้นั้น มีลักษณะของโครงสร้างผลึกแบบบูร์ไกล์และแบบอนาเทสโดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบได้โดยการประค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ จะมีค่าคงที่แลตทิชตรงตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920 และเลขที่ 89-4921 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4-1

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์สามารถคำนวณได้จากสมการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เตรียมได้ พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบโดยประค่าระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่างๆ จะมีขนาดผลึกเพิ่มขึ้นตามความเพิ่มของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โดยที่ระยะ d_{st} เท่ากับ 10 cm มีขนาดผลึก 13.62 nm เมื่อเพิ่มระยะ d_{st} เท่ากับ 12 cm ขนาดผลึกจะมีค่าเท่ากับ 29.60 nm และระยะ d_{st} เท่ากับ 14 cm ขนาดผลึกจะมีค่าเท่ากับ 33.92 nm สำหรับระยะ d_{st} เท่ากับ 16 cm และ 18 cm ไม่สามารถคำนวณขนาดผลึกได้ เนื่องจากไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมได้ออกไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่างๆ

ระยะห่างระหว่าง เป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	$a (\text{\AA})$	$c (\text{\AA})$	เฟส
JCPDS (89-4920)	4.584	2.953	rutile
JCPDS (89-4921)	3.777	9.501	anatase
10	4.609	2.939	rutile
12	3.786	9.671	anatase
14	3.789	9.522	anatase
16	-	-	amorphous
18	-	-	amorphous

ตารางที่ 4-2 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระหะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

ระยะห่างระหว่าง เป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	Intensity (a.u.)	β (องศา)	Crystallite size (nm)	เฟส
10	1542	0.60	13.62	rutile
12	1177	0.28	29.60	anatase
14	550	0.24	33.92	anatase
16	-	-	-	amorphous
18	-	-	-	amorphous

3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์

ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มไทเทนเนียมไดออกไซด์ซึ่งเคลือบที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยระยะ d_{st} เท่ากับ 10 cm ฟิล์มนีเกรนขนาดเล็ก กลมมน กระจายอยู่ทั่วบริเวณบนพื้นผิวน้ำฟิล์ม (ภาพที่ 4-3 (a)) เมื่อเพิ่มระยะ d_{st} เท่ากับ 12 cm และ 14 cm พื้นผิวฟิล์มนีลักษณะขรุขระ เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้นป้ายแหลมกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวน้ำฟิล์ม (ภาพที่ 4-3 (b) และ ภาพที่ 4-3 (c)) ส่วนระยะ d_{st} เท่ากับ 16 cm เกรนของฟิล์มนีขนาดเล็กป้ายแหลมบางบริเวณสูงบางบริเวณต่ำกระจายทั่วพื้นผิวน้ำฟิล์ม (ภาพที่ 4-3 (d)) และสุดท้ายที่ระยะ d_{st} เท่ากับ 18 cm พบว่าเกรนของฟิล์มส่วนใหญ่มีลักษณะกลมมนกระจายตัวผิวน้ำฟิล์มและมีเกรนของฟิล์มในลักษณะแหลมสูงผสมอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 4-3 (e))



ภาพที่ 4-3 ถักยนต์พื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทด์เนียมไคออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระบบห้าระห่ำหัวที่เป็นสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่างๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

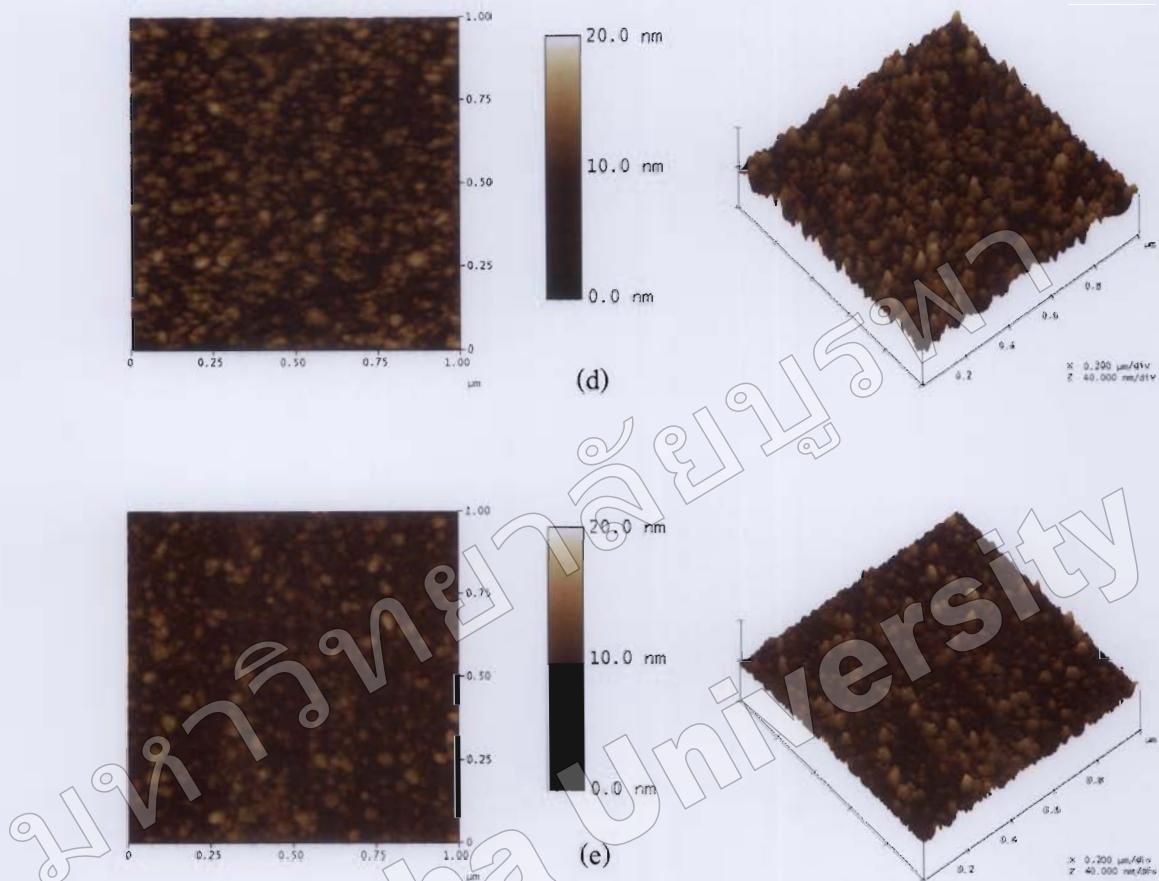
(a) $d_{st} = 10 \text{ cm}$

(b) $d_{st} = 12 \text{ cm}$

(c) $d_{st} = 14 \text{ cm}$

(d) $d_{st} = 16 \text{ cm}$

(e) $d_{st} = 18 \text{ cm}$



ภาพที่ 4-3 ถักขยะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มนางไ泰เนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

(a) $d_{st} = 10 \text{ cm}$

(b) $d_{st} = 12 \text{ cm}$

(c) $d_{st} = 14 \text{ cm}$

(d) $d_{st} = 16 \text{ cm}$

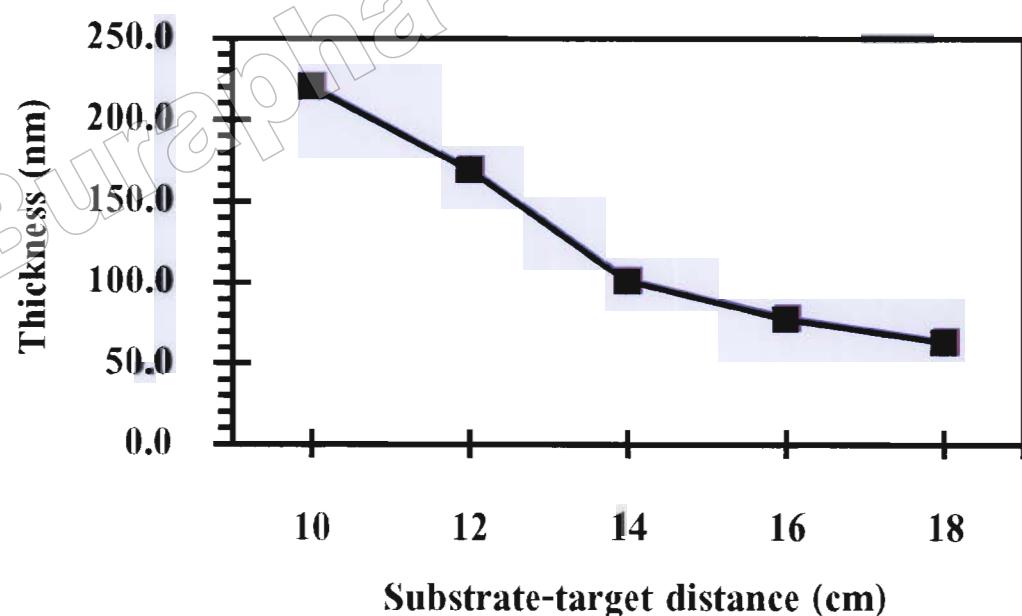
(e) $d_{st} = 18 \text{ cm}$

สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มนางไ泰เนียมไดออกไซด์เคลือบที่ ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ พนว่าเมื่อระยะ d_{st} เพิ่มขึ้น ความหนาฟิล์มนีค่าลดลงจาก 220 nm เป็น 63 nm (ภาพที่ 4-4) ส่วนความหยาบผิวเฉลี่ยของฟิล์มเคลือบที่ระยะ d_{st} เท่ากับ 10 cm มีความหยาบผิวเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 nm เมื่อเพิ่มระยะ d_{st} เท่ากับ 12 cm ฟิล์มนีความหยาบผิวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.37 nm ซึ่งเป็นค่ามากที่สุด และความหยาบผิวเฉลี่ยของ

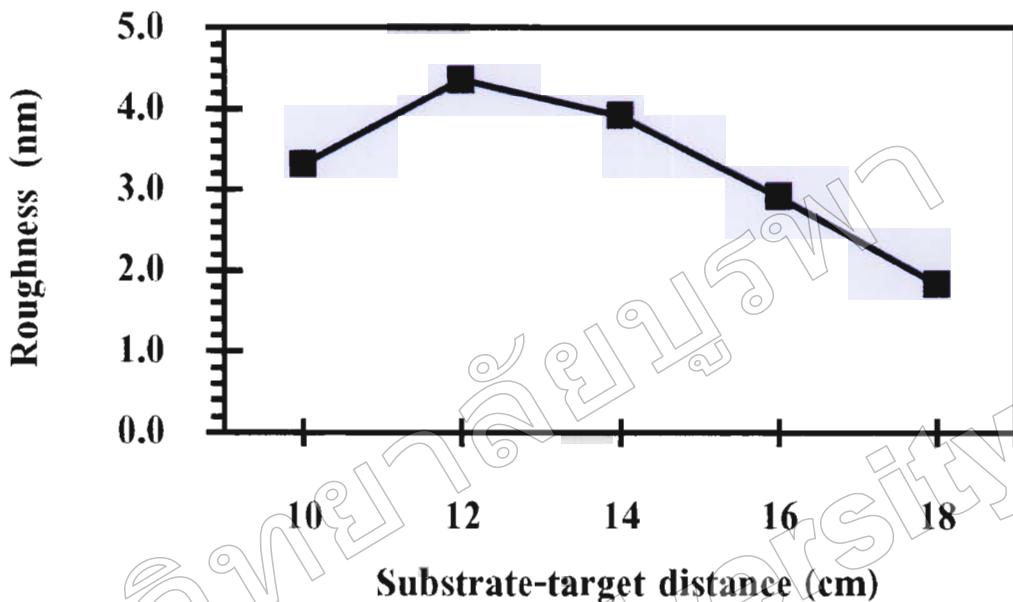
พิล์มลดลงจาก 3.92 nm เป็น 1.83 nm เมื่อระยะ d_s เพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 4-5) ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 ความหนา และความหยาบผิวของพิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยรัฐห่างระหว่างเปล่าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

ระยะห่างระหว่าง เปล่าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ (cm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
10	220	3.33
12	169	4.37
14	101	3.92
16	78	2.92
18	63	1.83



ภาพที่ 4-4 ความหนาของพิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระยะห่างระหว่างเปล่าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ



ภาพที่ 4-5 ความหมายพิวของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยระบบท่าระหว่าง เป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

ผลของอัตราไหลดแก๊สออกซิเจน

ส่วนนี้จะเป็นการเสนอผลการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 1 sccm ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 12 cm กำลังไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 220 W เวลาเคลือบคงที่เท่ากับ 120 min และแปรค่าอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm, 4 sccm และ 6 sccm ตามลำดับ มีผลดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์

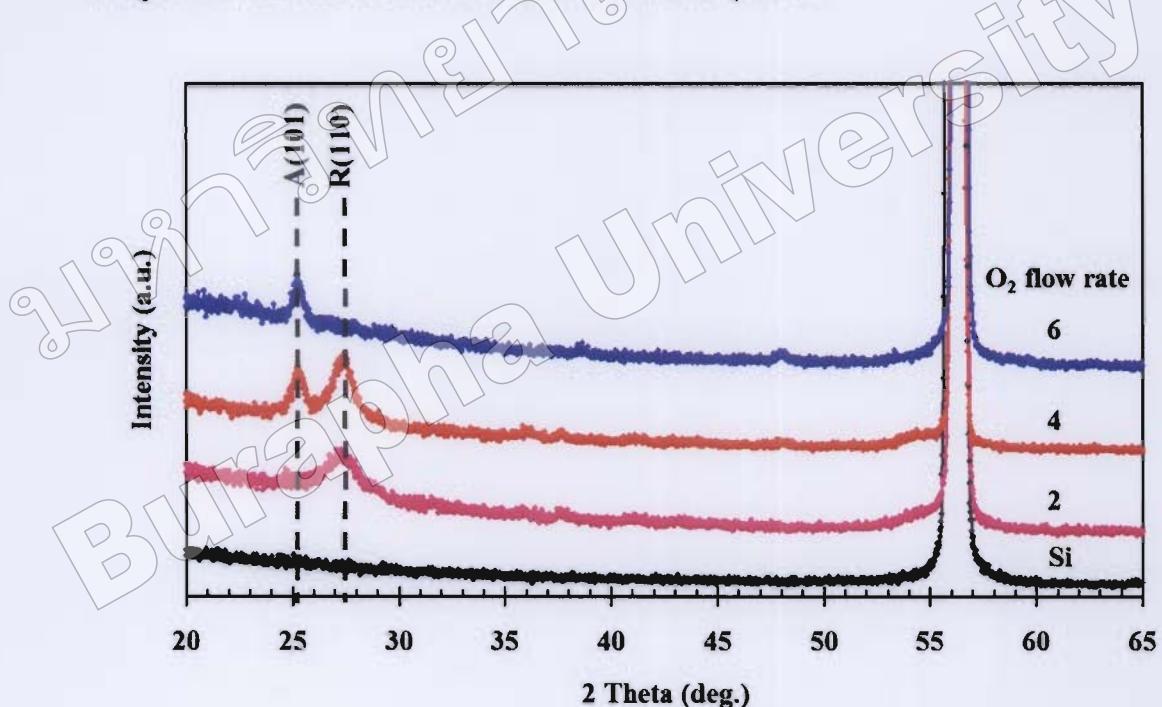
ฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบไดจากการแปรค่าอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลักษณะใสส่องผ่านแสงได้ดี มีเม็ดสีม่วงอ่อน ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-6 ลักษณะของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ เมื่อเคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

2. โครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

ภาพที่ 4-7 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยปริมาณอัตราไหกแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ พบว่า ฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหกแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 27.30° ตรงกับไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสธูไพลัสระนาบ (110) ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920 เมื่ออัตราไหกแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4 sccm ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.28° และ 27.34° ตรงกับไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคตระนาบ (101) และเฟสธูไพลัสระนาบ (110) ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 และเลขที่ 89-4920 ตามลำดับ สุดท้ายเมื่ออัตราไหกแก๊สออกซิเจนเพิ่มเป็น 6 sccm ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.26° ตรงกับไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคตระนาบ (101) ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 โดยที่มุม 56.50° เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของซิลิกอนซึ่งเป็นวัสดุรองรับ



ภาพที่ 4-7 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย อัตราไหกแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่เดตทิชของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถหาได้จากระยะห่างระหว่างรากนผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบบูรุ่งไอล์และแบบอนาเทส เนื่องจากฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีลักษณะของโครงสร้างผลึกแบบบูรุ่งไอล์และแบบอนาเทส ซึ่งสามารถทราบได้จากการรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าฟิล์มนางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราไอล์แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ จะมีค่าคงที่เดตทิชตรงตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920 และเลขที่ 89-4921 ตามลำดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-4

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ สามารถคำนวณได้จากสมการของ Seherrter โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์มนางที่ได้พบว่าฟิล์มนางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราไอล์แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ จะมีขนาดผลึกเพิ่มขึ้นตามความเข้มของ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ โดยที่อัตราไอล์แก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm ฟิล์มนางมีโครงสร้างแบบบูรุ่งไอล์ผสมแบบอนาเทส โดยมีขนาดผลึกเท่ากับ 18.58 nm และ 20.61 nm ตามลำดับ ส่วนอัตราไอล์แก๊สออกซิเจนเท่ากับ 6 sccm โครงสร้างแบบอนาเทส ขนาดผลึกเท่ากับ 28.07 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-4 ค่าคงที่เดตทิชของฟิล์มนางไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย อัตราไอล์แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราไอล์แก๊สออกซิเจน (sccm)	$a (\text{\AA})$	$c (\text{\AA})$	เฟส
JCPDS (89-4920)	4.584	2.953	rutile
JCPDS (89-4921)	3.777	9.501	anatase
2	4.616	2.915	rutile
4	3.788	9.535	anatase
	4.610	2.936	rutile
6	3.780	9.535	anatase

ตารางที่ 4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราไหลดแก๊สออกซิเจน (sccm)	Intensity (a.u.)	β (องศา)	Crystallite size (nm)	เฟส
2	640	0.012	11.67	rutile
4	613	0.007	20.61	anatase
	697	0.008	18.58	rutile
6	690	0.005	28.07	anatase

3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไไทเทเนียมไดออกไซด์

ภาพที่ 4-8 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มไไทเทเนียมไดออกไซด์ เคลือบที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ พบว่าฟิล์มไไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2 sccm พื้นผิวของฟิล์มมีเกรนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวหน้าฟิล์ม สำหรับ ฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 4 sccm พื้นผิวมีเกรนขนาดเล็กใหญ่ปะปนกัน กระจายอยู่บนบริเวณ ส่วนฟิล์มเคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 6 sccm พื้นผิวมีลักษณะ ขรุขระ ทำให้ฟิล์มที่ได้มีพื้นที่ผิวมากที่สุดเมื่อเทียบกับฟิล์มที่ได้เมื่อใช้อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่ำ สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่า เมื่ออัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความหนาฟิล์มนิ่ค่าลดลง จาก 171 nm เป็น 136 nm (ภาพที่ 4-9) และที่ความหยาบผิวเฉลี่ยของฟิล์มนิ่คเพิ่มขึ้นจาก 2.00 nm เป็น 5.42 nm (ภาพที่ 4-10) ดังแสดง ข้อมูลในตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มบางไไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราไหลดแก๊สออกซิเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
2	171	2.00
4	155	4.70
6	136	5.42

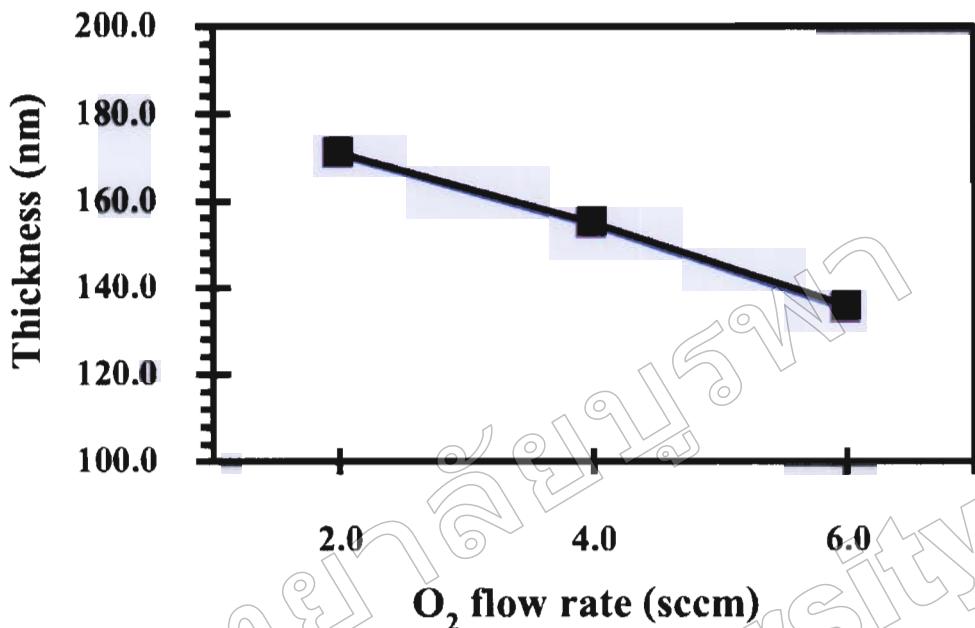


ภาพที่ 4-8 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

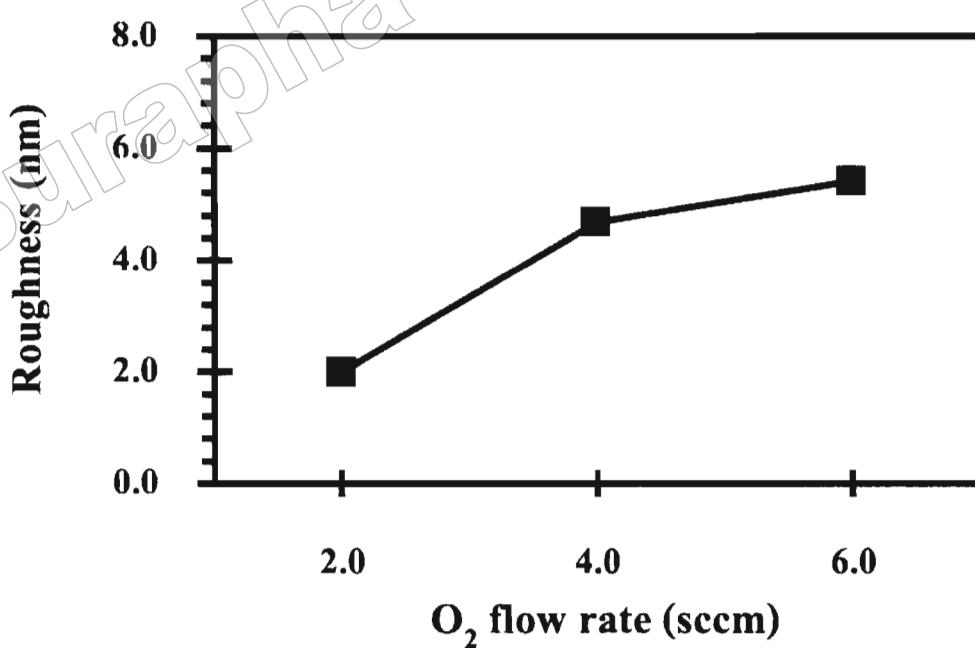
(a) 2 sccm

(b) 4 sccm

(c) 6 sccm



ภาพที่ 4-9 ความหนาของฟิล์มบางไทเทนเนียม ไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย
อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ



ภาพที่ 4-10 ความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทนเนียม ไดออกไซด์ เมื่อเคลือบด้วย
อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

ผลทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์

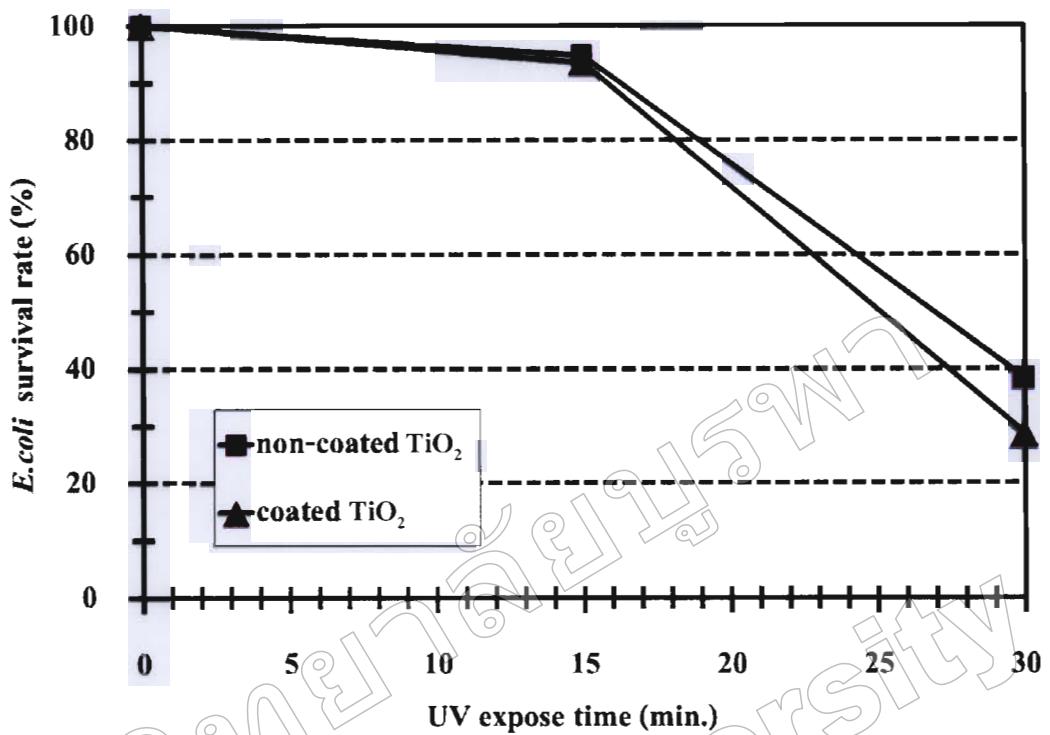
ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ โครงสร้างแบบอนาเทส ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอลेटที่เวลาต่าง ๆ กัน ซึ่งฟิล์มบางที่เคลือบได้สามารถเตรียมด้วยวิธีรีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราไฟลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 1 sccm : 6 sccm ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบ กับวัสดุรองรับเท่ากับ 12 cm กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 220 W และใช้เวลาเคลือบนาน 120 min ซึ่งจากการทดลองข้างต้น เงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้ได้ฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอนาเทส จากนั้นนำฟิล์มบางที่เคลือบได้มาทำการศึกษาความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* มีผลดังนี้

ผลการทดสอบเมืองตัน

การทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยการไม่ฉายรับแสงอัลตราไวโอลे�ต บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ที่เวลา 0 นาที ถึง 30 นาที พบว่า จำนวนเชื้อ *E. coli* เริ่มต้นบนกระจกไม่เคลือบฟิล์มและเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ มีจำนวนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ 19.40×10^5 CFU/ml และ 18.80×10^5 CFU/ml ตามลำดับ เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดชีวิตบนกระจกไม่เคลือบฟิล์มและเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์จะค่อย ๆ ลดลง และมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งตารางที่ 4.7 แสดงอัตราการลดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ เมื่อไม่ได้ฉายรับแสงที่เวลาต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4-11 ส่วนโคโนนีและลักษณะของเชื้อ *E. coli* แสดงดังภาพที่ 4-12

ตารางที่ 4-7 จำนวนโคโนนีของเชื้อ *E. coli* บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์เมื่อไม่ฉายรับแสงอัลตราไวโอลे�ต ที่เวลาต่าง ๆ

เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที)	จำนวนโคโนนี (CFU/ml)	
	ไม่เคลือบฟิล์ม TiO ₂	เคลือบฟิล์ม TiO ₂
0	19.40×10^5	18.80×10^5
15	18.40×10^5	17.60×10^5
30	7.50×10^5	5.40×10^5



ภาพที่ 4-11 อัตราการลดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระดาษไม่เคลือบและเคลือบพิล์มบาง ไทดเนียม ไดออกไซด์เมื่อไม่加以รับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 4-12 ลักษณะของเชื้อ *E. coli* เมื่อไม่加以รับแสงอัลตราไวโอดেต ที่เวลาต่าง ๆ

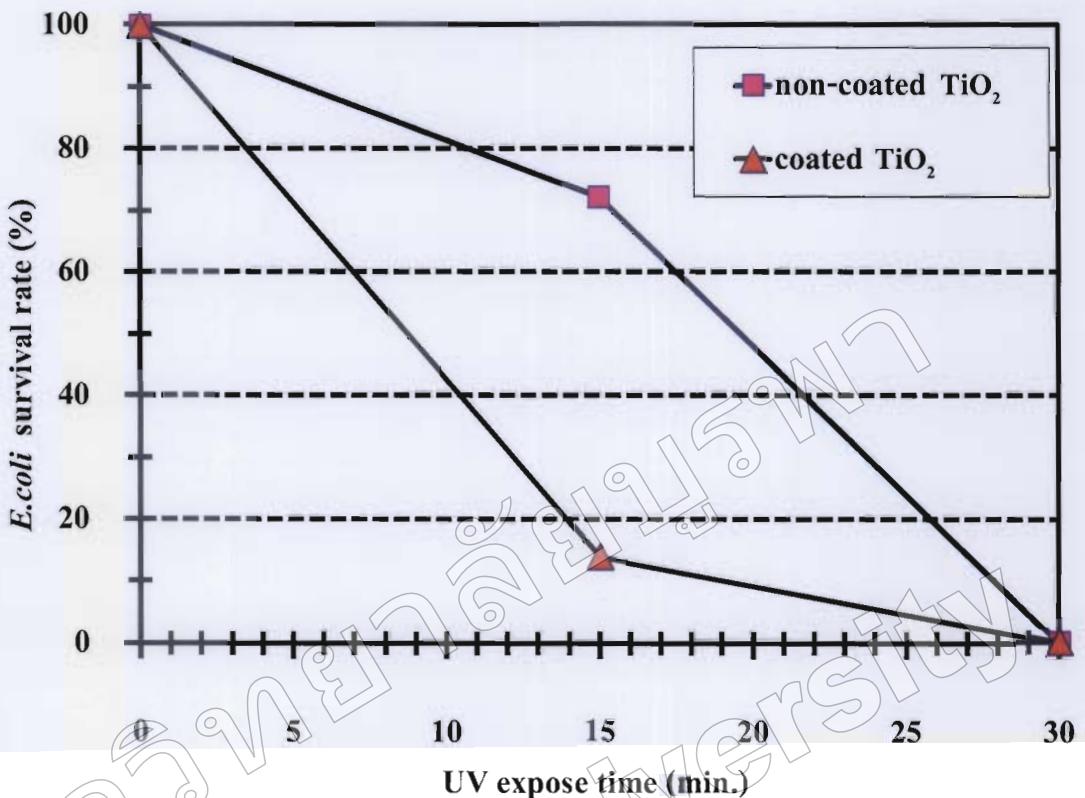
(a) กระจากไม่เคลือบฟิล์ม

(b) กระจากเคลือบฟิล์ม

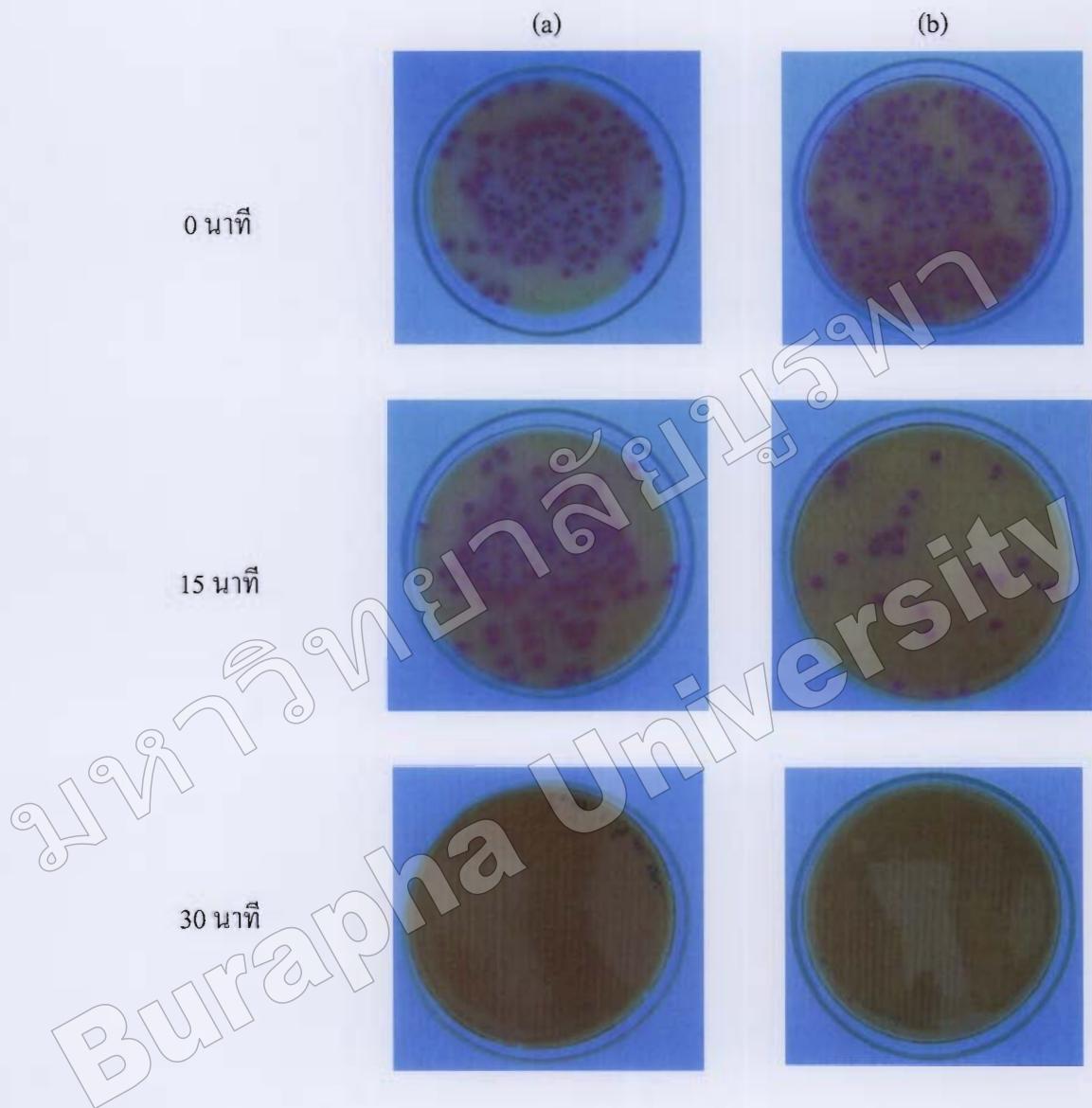
ตารางที่ 4-8 แสดงจำนวนโคโลนีของเชื้อ *E. coli* ที่รอดตาย เมื่อจายรับแสงอัลตราไวโอล็อกที่เวลาต่าง ๆ กัน เปรียบเทียบผลกระทบห่วงกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์ พบร้ากระจากเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เมื่อจายรับแสง มีความสามารถในการยับเชื้อ *E. coli* ได้ดีกว่ากระจากไม่เคลือบฟิล์ม ซึ่งตารางที่ 4-8 ได้แสดงค่าเปรียบเทียบของจำนวนเชื้อ *E. coli* บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์ม เมื่อนำไปจายรับแสงอัลตราไวโอล็อกที่เวลา 0 นาที ถึง 30 นาที พบร้าจำนวนเชื้อ *E. coli* ก่อนจายรับแสงอัลตราไวโอล็อก บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มมีจำนวนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ 19.40×10^5 CFU/ml และ 18.80×10^5 CFU/ml ตามลำดับ เมื่อนำไปจายรับแสงอัลตราไวโอล็อก พบร้าจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดบนกระจกเคลือบฟิล์มนี้ค่าน้อยกว่าบนกระจกไม่เคลือบฟิล์ม และไม่พบร้าจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่รอดตายเมื่อจายแสงเป็นเวลานาน 30 นาที ขณะที่กระจกไม่เคลือบฟิล์มเมื่อจายรับแสงที่เวลาต่าง ๆ มีจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดต่ำลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งอัตราการรอดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มนี้อยู่ในรากการจายแสงที่เวลาต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4-13 ส่วนโคโลนีและถักยะยะของเชื้อ *E. coli* แสดงดังภาพที่ 4-14

ตารางที่ 4-8 จำนวนโคโลนีของเชื้อ *E. coli* บนกระจกไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เมื่อจายรับแสงอัลตราไวโอล็อก ที่เวลาต่าง ๆ

เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที)	จำนวนโคโลนี (CFU/ml)	
	ไม่เคลือบฟิล์ม TiO_2	เคลือบฟิล์ม TiO_2
0	19.40×10^5	18.80×10^5
15	14.00×10^5	2.60×10^5
30	0	0



ภาพที่ 4-13 อัตราการรอดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระดาษไม่เคลือบและเคลือบพิล์มบาง ไทดเนี่ยน
ไดออกไซด์เมอกาบาร์บันส์อัลตร้าไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 4-14 ลักษณะของเชื้อ *E. coli* เมื่อนำรับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ

(a) กระดาษไม่เคลือบฟิล์ม

(b) กระดาษเคลือบฟิล์ม

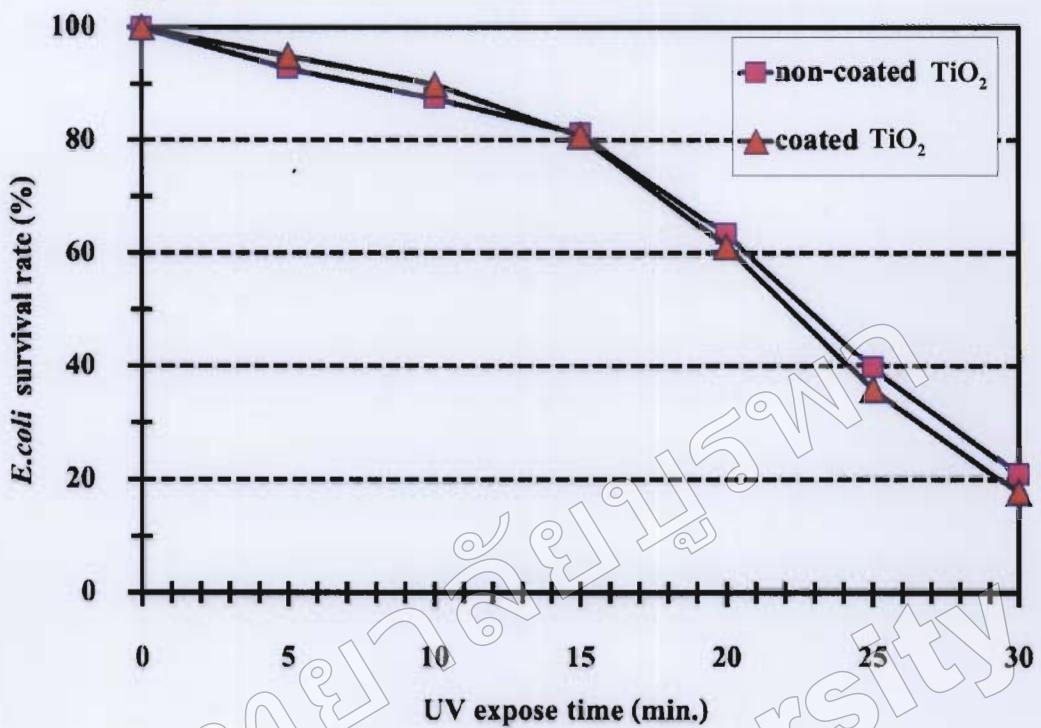
ผลการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์

จากการทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ในเบื้องต้น พบว่าแสงอัลตราไวโอเลตมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *E. coli* ในส่วนนี้ เป็นการศึกษาผลการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์เมื่อยูกะรุคุณค่าวัสดุ แสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ กัน มีผลดังนี้

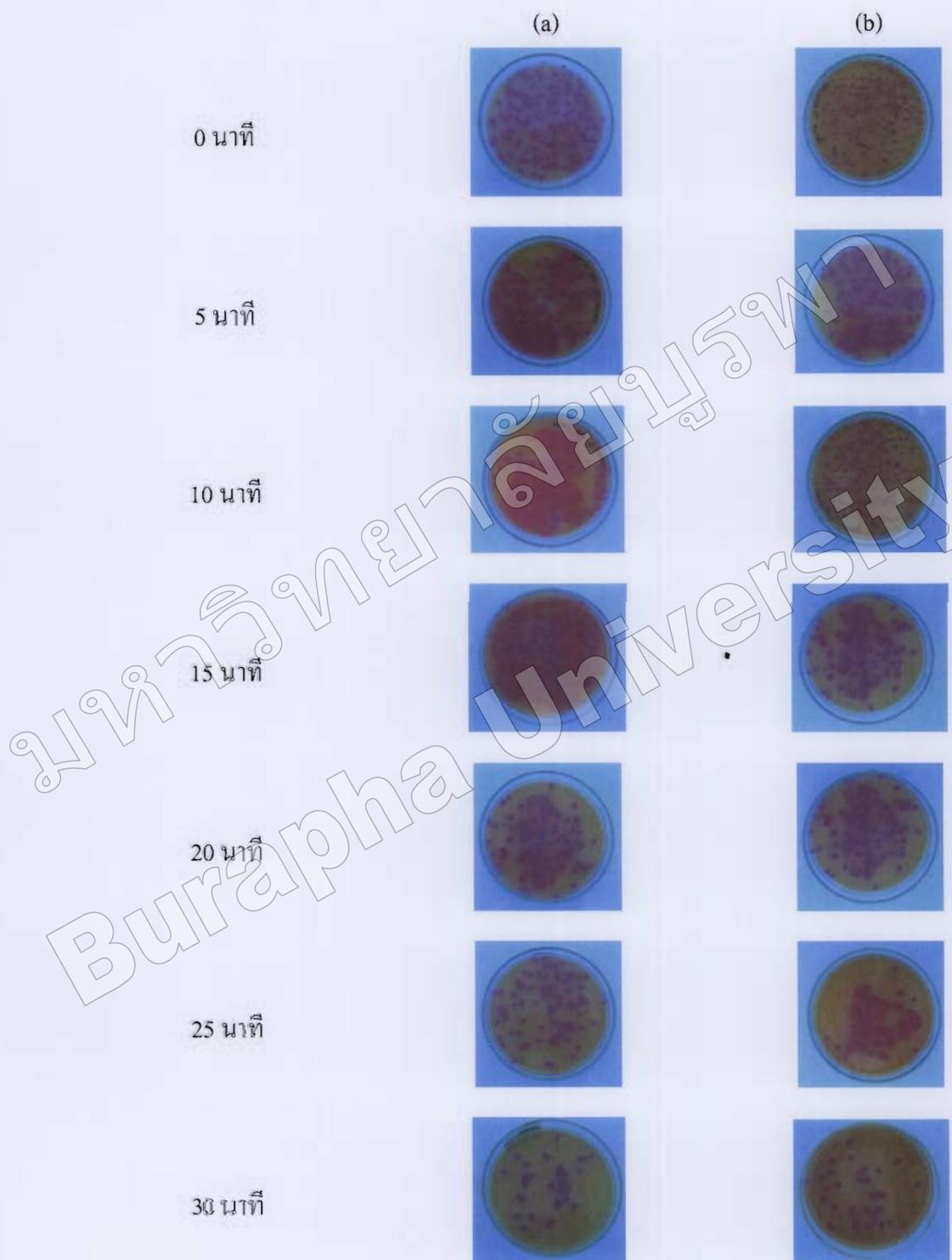
การทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยการไม่ฉายรับแสงอัลตราไวโอเลต บนกระจากไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์ ที่เวลา 0 นาที ถึง 30 นาที พบว่า จำนวนเชื้อ *E. coli* เริ่มต้นบนกระจากไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์มีจำนวน แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ 20.70×10^5 CFU/ml และ 19.80×10^5 CFU/ml ตามลำดับ เมื่อเวลา ผ่านไป จำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดชีวิตบนกระจากไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์ จะค่อย ๆ ลดลงและมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งตารางที่ 4.9 แสดงอัตราการลดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระจากไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์เมื่อไม่ได้ฉายรับแสง ที่เวลาต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4-15 ส่วนโคลนนิและลักษณะของเชื้อ *E. coli* แสดงดังภาพที่ 4-16

ตารางที่ 4-9 จำนวนโคลนนิของเชื้อ *E. coli* บนกระจากไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำไทยเนยนไกออกไซด์เมื่อไม่ฉายรับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ

เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที)	จำนวนโคลนนิ (CFU/ml)	
	ไม่เคลือบพิล์มน้ำ TiO_2	เคลือบพิล์มน้ำ TiO_2
0	20.70×10^5	19.80×10^5
5	19.20×10^5	18.80×10^5
10	18.10×10^5	17.80×10^5
15	16.80×10^5	16.00×10^5
20	13.10×10^5	12.10×10^5
25	8.20×10^5	7.10×10^5
30	4.30×10^5	3.50×10^5



ภาพที่ 4-15 อัตราการลดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระดาษไม่เคลือบและเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไกօอกไซด์เมื่อไม่加以รับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 4-16 ลักษณะของเชื้อ *E. coli* เมื่อไม่加以รับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ

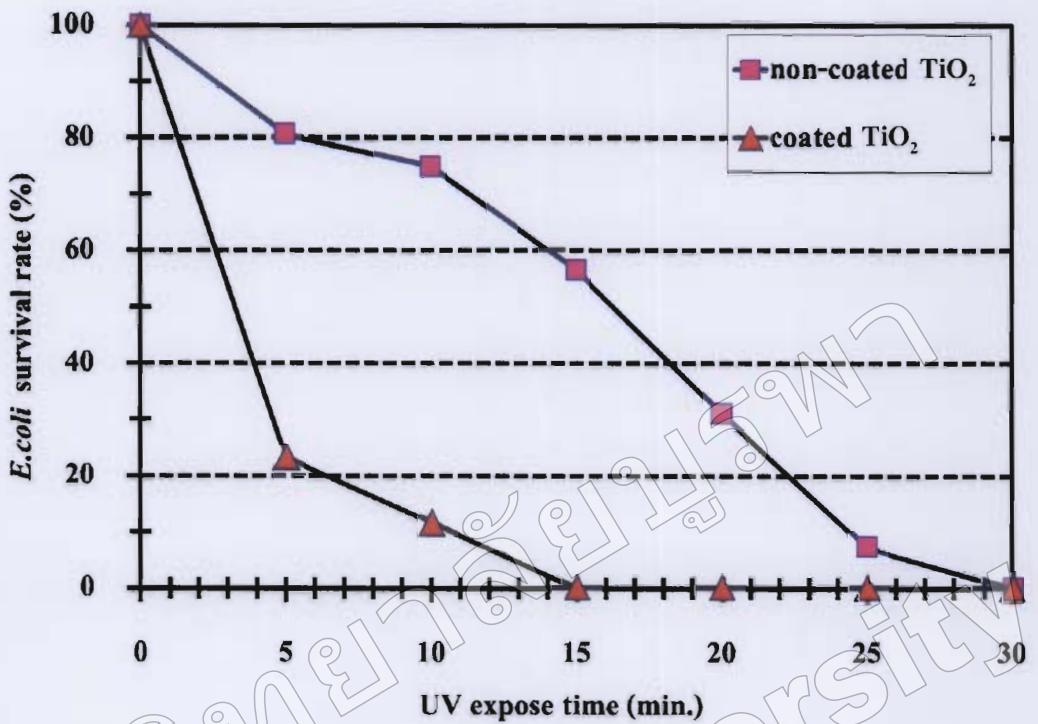
(a) กระจกไม่เคลือบฟิล์ม

(b) กระจกเคลือบฟิล์ม

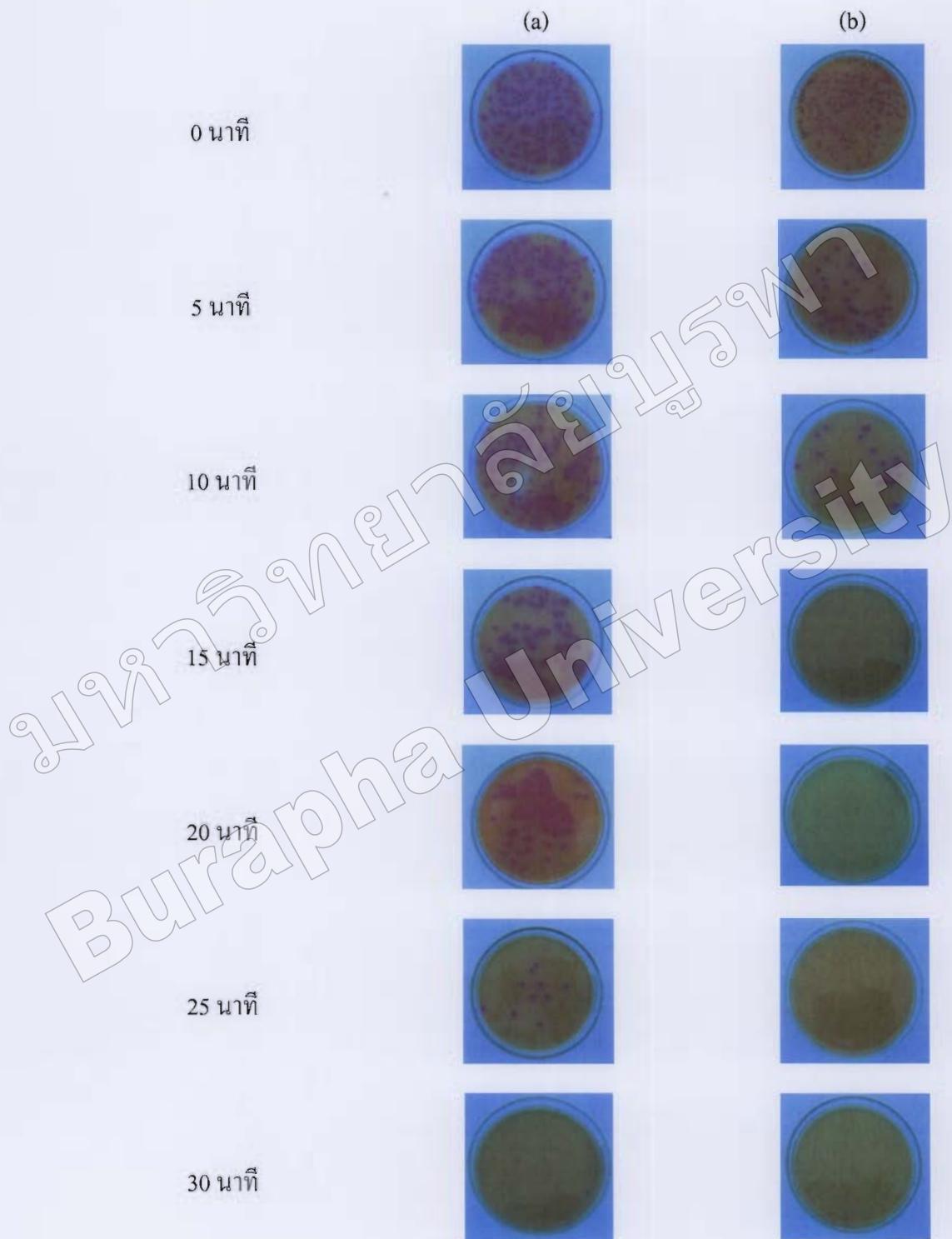
ตารางที่ 4-10 แสดงจำนวนโคโลนีของเชื้อ *E. coli* ที่รอดตายเมื่อจายรับแสง อัลตราไวโอลูเตตที่เวลาต่าง ๆ เปรียบเทียบผลกระทบว่า ผลกระทบไม่เคลือบและเคลือบพิล์มบาง ไทยเทเนียม ได้ออกใช้ค์ พบร่วมกับผลกระทบเคลือบพิล์มบาง ไทยเทเนียม ได้ออกใช้ค์ เมื่อถูกจายรับแสง มีความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ได้ดีกว่าผลกระทบไม่เคลือบพิล์ม ซึ่งตารางที่ 4-10 ได้แสดงค่าเปรียบเทียบของจำนวนเชื้อ *E. coli* บนผลกระทบไม่เคลือบและเคลือบพิล์ม เมื่อนำไปจายรับแสง อัลตราไวโอลูเตตที่เวลา 0 นาที ถึง 30 นาที พบร่วมกับจำนวนเชื้อ *E. coli* ก่อนจายรับแสง อัลตราไวโอลูเตต บนผลกระทบไม่เคลือบและเคลือบพิล์ม มีจำนวนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยคือ 20.70×10^5 CFU/ml และ 19.80×10^5 CFU/ml ตามลำดับ เมื่อนำไปจายรับแสง อัลตราไวโอลูเตต พบร่วมกับจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดบนผลกระทบเคลือบพิล์ม มีค่าน้อยกว่าบนผลกระทบไม่เคลือบพิล์ม และไม่พบจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่รอดตายเมื่อจายแสงเป็นเวลาระหว่าง 15 นาที ขณะที่ผลกระทบไม่เคลือบพิล์มและถูกจายรับแสงที่เวลาต่าง ๆ มีจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดตายค่อยๆ ลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น และไม่พบจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่รอดตายเมื่อจายแสงเป็นเวลาระหว่าง 30 นาที ซึ่งอัตราการรอดตายเชื้อ *E. coli* บนผลกระทบไม่เคลือบและเคลือบพิล์มบาง ไทยเทเนียม ได้ออกใช้ค์ และถูกจายรับแสงที่เวลาต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4-17 สำหรับโคโลนีและลักษณะของเชื้อ *E. coli* แสดงดังภาพที่ 4-18

ตารางที่ 4-10 จำนวนโคโลนีของเชื้อ *E. coli* บนผลกระทบไม่เคลือบและเคลือบพิล์มบาง ไทยเทเนียม ได้ออกใช้ค์ เมื่อจายรับแสง อัลตราไวโอลูเตต ที่เวลาต่าง ๆ

เวลาที่ใช้ในการทดลอง (นาที)	จำนวนโคโลนี (CFU/ml)	
	ไม่เคลือบพิล์ม TiO ₂	เคลือบพิล์ม TiO ₂
0	20.70×10^5	19.80×10^5
5	16.70×10^5	4.60×10^5
10	15.50×10^5	2.30×10^5
15	11.74×10^5	0
20	6.40×10^5	0
25	1.00×10^5	0
30	0	0



ภาพที่ 4-17 อัตราการลดตายของเชื้อ *E. coli* บนกระดาษไม้เคลือบและเคลือบฟิล์มนางไหเทเนี่ยน
โดยอุ่นไอน้ำเมื่อจ่ายรับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 4-18 ลักษณะของเชื้อ *E. coli* เมื่อจ่ายรับแสงอัลตราไวโอเลต ที่เวลาต่าง ๆ

(a) กระเจกไม่เคลือบฟิล์ม

(b) กระเจกเคลือบฟิล์ม